



现在位置: 首页 > 新闻动态 > 合作交流

## 新闻动态

- ▶ 图片新闻
- ▶ 头条新闻
- ▶ 综合新闻
- ▶ 学术活动
- ▶ 科研动态
- ▶ 通知公告
- ▶ 业内信息
- ▶ 合作交流

### Mentor公司代表团访问微电子所及中科

2010-10-12 | 编辑: 七室 刘佳劫 | 【大 中 小】 【打

9月14日, EDA工具厂商Mentor公司代表团访问了微电子所, 进一步加强合作进行了座谈。

会议特别邀请Mentor公司大客户项目经理张淑雯做主题报告, 介绍Mentor公司大客户服务团队在解决客户工艺制程面临的挑战以及Mentor提供的DFM相关解决方案。中国科学院微电子研究所所长刘亚明主持了本次会议, Mentor公司亚太区技术总监Andrew先生、副总监David博士以及声学所、自动化所、计算所等EDA中心会员单位代表参加了会议。

交流会上, 张淑雯女士首先介绍了65nm及以下工艺芯片制造中遇到的挑战, 包括particle所引起的短路断路、光刻和化学机械抛光所带来的一些问题随着关键尺寸的缩小而变得越发严重, 已经无法通过简单的工艺调整来解决, 芯片可制造性的问题, 逐步转移到了上游设计者的手中, 在现有的工艺条件下, 是否能具有较高的加工良率。Mentor Graphics提供关键区域分析(CAA)工具、光刻友好设计(LFD)工具、寄生分析和ESD分析工具等。这些工具都是通过了代工厂所提供大量数据, 提供了一个可靠的虚拟平台来提前检验自身设计, 大大缩短验证时间。例如, CMP模拟分析结合Smart-Fill工具可以有效解决化学机械抛光问题, ESD分析工具PERC提供了包括Pin-to-Pin Resistance和Current Flow分析。作为Mentor重要合作伙伴单位的中芯国际, 其DFM部门负责SMIC65/45nm流程中的DFM相关内容。

会后, Andrew先生还与EDA中心的部分技术人员进行了交流。

